

平成 17 年 7 月期 決算短信（非連結）

平成 17 年 9 月 16 日

会 社 名 サムコ 株式会社

コ ー ド 番 号 6 3 8 7

( U R L <http://www.samco.co.jp> )

本 社 所 在 地 京都府京都市伏見区竹田藁屋町 36 番地

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 辻 理

問合せ先責任者 管理本部長兼経理部長 田井 彰

決算取締役会開催日 平成 17 年 9 月 16 日

定時株主総会開催日 平成 17 年 10 月 25 日

配当支払開始予定日 平成 17 年 10 月 26 日

上場取引所 J A S D A Q

本社所在都道府県 京都府

T E L (075) 621 - 7841

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

### 1. 17 年 7 月期の業績 ( 平成 16 年 8 月 1 日 ~ 平成 17 年 7 月 31 日 )

#### (1) 経営成績

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 7 月期	3,090	( 8.4 )	258	( 40.6 )	263	( 35.9 )
16 年 7 月期	3,374	( 1.8 )	434	( 4.3 )	411	( 4.3 )

	当 期 純 利 益		1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 經 常 利 益 率	売 上 高 經 常 利 益 率
	百 万 円	%	円 錢	円 錢	%	%	%
17 年 7 月期	166	( 33.9 )	33 96		3.3	3.8	8.5
16 年 7 月期	251	( 13.5 )	50 71		5.2	5.8	12.2

- (注) 1. 持分法投資損益 17 年 7 月期 百万円 16 年 7 月期 百万円  
 2. 期中平均株式数 17 年 7 月期 4,889,140 株 16 年 7 月期 4,889,140 株  
 3. 会計処理の方法の変更 無  
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率  
 5. 期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式控除後のものです。

#### (2) 配当状況

	1 株 当 た り 年 間 配 当 金		配 当 金 総 額 ( 年 間 )	配 当 性 向	株 主 資 本 配 当 率
	中 間	期 末			
17 年 7 月期	円 錢 12 50	円 錢 12 50	百万円 61	% 36.8	% 1.2
16 年 7 月期	円 錢 15 00	円 錢 15 00	百万円 73	% 29.6	% 1.5

#### (3) 財政状態

	総 資 産		株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1 株 当 た り 株 主 資 本
	百 万 円		百 万 円	%	円 錢
17 年 7 月期	6,830		5,046	73.9	1,032 11
16 年 7 月期	6,997		4,982	71.2	1,018 48

- (注) 1. 期末発行済株式数 17 年 7 月期 4,889,140 株 16 年 7 月期 4,889,140 株  
 2. 期末自己株式数 17 年 7 月期 1,750 株 16 年 7 月期 1,750 株

#### (4) キャッシュ・フローの状況

	営 業 活 動 に よ る キャッシュ・フロー		投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高
	百 万 円		百 万 円	百 万 円	百 万 円
17 年 7 月期	168		47	168	1,122
16 年 7 月期	405		69	407	1,170

### 2. 18 年 7 月期の業績予想 ( 平成 17 年 8 月 1 日 ~ 平成 18 年 7 月 31 日 )

	賣 上 高	經 常 利 益	當 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金		
				中 間	期 末	円 錢
中 間 期	百 万 円 1,720	百 万 円 226	百 万 円 135			
通 期	4,100	740	444	12 50	12 50	

(参考) 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 ( 通 期 ) 90 円 13 錢

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる場合があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、添付書類の 7 ページを参照してください。

## 添付書類

### 1. 企業集団の状況

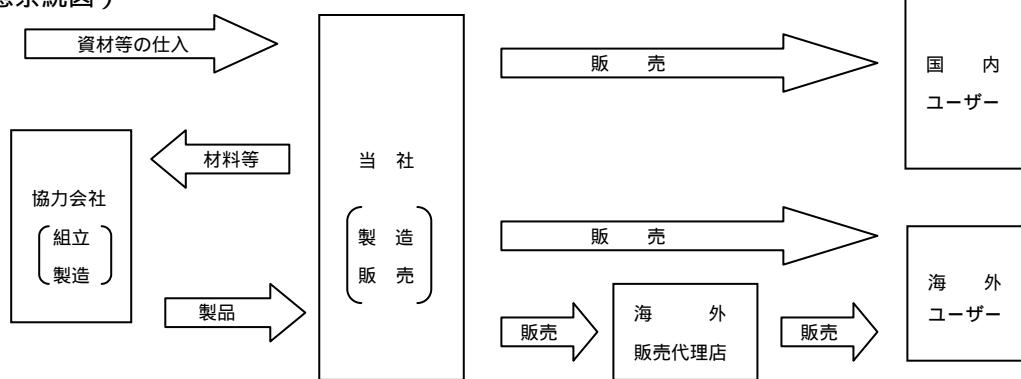
当社は、単独で事業を営んでおり、親会社や関係会社はありません。

当社は、半導体等電子部品製造装置メーカーで、薄膜形成・加工装置の製造及び販売を事業としております。当社の基本となる薄膜形成技術は CVD 法 ( Chemical Vapor Deposition = 化学的気相成長法 ) によるもので、当社の各装置においては、ナノテクノロジーと言われる 10nm ~ 100 μmまでの成膜や加工が可能であります。( nm = ナノメートル : 1 億分の 1 メートル μm = マイクロメートル : 1 百万分の 1 メートル )

当社の製品は、薄膜を形成する CVD 装置、薄膜を微細加工するエッティング装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品出荷の前に独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行うとともに、海外については一部現地販売代理店に委託しており、これらの関係を図示すると以下の通りとなっております。

( 業態系統図 )



当社は装置等を以下の通りに区分しております。

#### ( CVD 装置 )

反応性の気体を基板の上に堆積させる装置で、一般に減圧下で半導体の絶縁膜、光学薄膜などを形成するために使われます。特に当社は発火性のガスを使用しない液体原料を活用した LS - CVD 装置 ( LS = Liquid Source ) に特徴があり、比較的低温反応で成膜速度が速く、均一性の良い成膜が可能であります。

#### ( エッティング装置 )

各種半導体の基板上の膜をはじめ微細加工が必要な材料を切削加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻していくものです。当社は ICP ( Inductive Coupled Plasma = 高密度プラズマ ) を利用したエッティングに特徴があり、高速かつ均一性の優れた加工が可能であります。

#### ( 洗浄装置 )

当社の装置は溶液を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求されるフィルム状実装基板などに使用されております。

#### ( その他装置 )

上記装置には含まれない特別な装置であります。

#### ( その他 )

部品、保守メンテナンスなどであります。

## 2. 経営方針

### (1) 経営の基本方針

当社は「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」ことを経営理念とし、  
社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。  
直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。  
事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値の追求を目標とし、株主、取引先、役員、  
従業員に対し、適切な成果の配分をする。  
を経営方針に掲げ、事業を展開しております。

### (2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けております。経営体質の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。

### (3) 投資単位の引き下げについて

当社は、当社株式の流動性の向上と株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。  
特に1単元株式数の見直しによる株式投資単位の引き下げにつきましては、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるために実行すべき課題として認識しております。当社では、既に、平成16年12月1日付をもって1単元の株式の数を1,000株から100株に変更し、株主数は現在増加傾向にあります。更なる引下げにつきましては、今後の動向を見ながら慎重に検討し対処いたしたいと考えております。

### (4) 目標とする経営指標

当社は中期的にも収益力の高い企業であり続けようと考えております。そのため売上高総利益率50%を確保し売上高の拡大により売上高経常利益率20%台への向上、維持を目指します。売上高の拡大のためには、研究開発用途向け装置に加えて生産用途向け装置の拡販に努めるとともに、海外売上高比率を現在の10%台から30%台へ引上げる方針です。

### (5) 中長期的な会社の経営戦略

当社は化合物半導体を中心としたオプトエレクトロニクス分野に経営資源を集中しながら、中期的には次の3点について戦略を展開してまいります。第一は、既に各種バックライトとして実用化の盛んな白色および青色LED(Light Emitting Diode=発光ダイオード)や次世代大容量光ディスク用途向けに注目されている青色LD(Laser Diode=半導体レーザー)の量産化への対応及び各種センサーやチップが日々開発されて拡大している各種電子部品分野等への対応のため、本格的な生産用装置を開発し、メンテナンスを含めた販売力を強化していくことあります。第二は、これらの分野も含めて、生産用と研究開発用が同時進行で拡大すると予想されている中国市場への積極展開であります。昨年11月に上海事務所を開設し、販売力の強化とアフターサービスの向上を図っており、早くも成果が現われております。第三は、CVD装置、エッチャリング装置、洗浄装置といった当社の三大製品群に匹敵するIT分野の第四の柱を確立することあります。当社は、米国シリコンバレー、英国ケンブリッジとの3極体制で行っている研究開発と国内の大学や各種クラスターとの共同研究を行っておりますが、これらの中から、薄膜事業に関連する新事業、新分野をいち早く立ち上げ、当社の中期的な事業拡大に寄与する事業に成長させたいと考えております。

### (6) 対処すべき課題

#### 現状の認識について

現状、デジタル家電関連の設備投資にも回復感が見られる中、白色および青色LED、LDが牽引役となるオプトエレクトロニクス市場では、今後自動車関連部品や一般照明用に巨大市場の出現が予想されます。また、三次元実装などで高性能化を進める電子部品分野や液晶に代わる次世代のディスプレーとして期待される有機EL(Electro Luminescence)用途などの表示デバイス分野での需要の拡大が見込まれます。これまで当社装置の中心的用途となっていた研究開発用途に加え生産用途としての生産用装置の開発と販売・メンテナンス体制の確立を急ぐことが重要と考えております。また、これらの展開はグローバル化しており、特に中国市場は重点市場として昨年開設いたしました上海事務所における拡販が重要であると認識しております。

#### 当面の対処すべき課題の内容

当面の課題は前期に投入いたしました量産用CVD装置と独口パートボッシュ社より技術導入いたしました「ボッシュプロセス」を取り入れたICPドライエッチャリング装置の性能向上と販売力強化であ

ります。また、オプトエレクトロニクス分野の LED、LD 用途向けの新型 MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)装置の商品化も重点的課題であります。そのためには、経営資源の集中とより一層の人材育成が必要であると考えております。

#### 対処方針

生産用装置の販売力強化はスケジュール通り実行中であります。適材適所の人材については、スキル保有人材を中心に各方面に広く門戸を開放し、中途採用を強化するとともに、独自の社内研修システムを確立していく方針であります。

#### 具体的な取組み状況等

設立25周年の昨年、生産機分野への本格的参入による新たな成長に向けての決意を社内外に表明し、新しい企業イメージをアピールするため、平成16年12月1日付で旧商号「株式会社サムコインターナショナル研究所」から新商号「サムコ 株式会社」へ社名変更いたしました。今年2月1日には組織変更を行い、「生産機事業部」を新設いたしました。専任部署として開発から設計・営業・製造・納入までの全工程を一元的に統括管理し、新市場の開拓、顧客ニーズへの対応強化による拡販に注力しております。また、重点部門に絞った中途採用人材の募集のみならず、広く事業拡大に伴う業務提携についても検討中であります。ただし、先方の技術力の評価と当社の業容との相乗効果を考慮しながら決定していく方針であります。

### (7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

#### (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 )

当社では、効率的で健全な企業経営システムを構築する上で、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な経営課題であると認識しており、常に組織の見直しと諸制度の整備に取組んでおります。  
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 )

a . 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

#### 会社の機関の内容

当社の株主総会は、設立時からの7月決算を貫くことにより、参加しやすく開かれた総会を目指しており、また取締役会は、意思決定の迅速化と経営責任を明確化するため、月1回以上の開催を定例化し、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、監査役の参加のもと、業務の執行状況の管理監督がなされております。当社の取締役は6名ですが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しながら、開かれた運営を基本としております。当社は監査役制度を採用しておりますが、監査役は4名のうち山田史郎氏が常勤監査役で残り3名は全員社外監査役であり、取締役の職務執行の適法性と妥当性をチェックし、公正な意見が発言できる仕組みを作り上げております。

#### 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況

内部統制については、内部監査室が年間計画に基づく業務監査を実施して、内部牽制の実効性を高めてあります。内部監査室は、業務活動の全般に関し、その妥当性や有効性及び法規制・社内ルールの遵守状況等について定期的に監査を実施し、各部署に助言・勧告を行うとともに経営者に速やかに報告いたします。リスク管理については、管理本部内の総務部が窓口となって各部門から適宜報告を受けるとともに、コンプライアンスの監視、リスク・チェックの強化に取り組んでおります。顧問弁護士からはコーポレート・ガバナンス体制、法律面等についての公正かつ適切な助言、指導を受けております。今後も、経営内容の透明性を高め各ステークホルダーから信頼される企業を目指して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

#### 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

内部監査室は、監査役と連携して社内各部門の業務執行状況について、定期的な業務監査をおこなっております。監査役は取締役会に出席するほか、定例的に開催される重要な会議に出席し、経営監視の機能を果たしております。会計監査は、あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づき会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。

指定社員 業務執行社員 米林 彰 あずさ監査法人

指定社員 業務執行社員 宮林 利朗 あずさ監査法人

継続監査年数については、2名共に7年以内であるため、記載を省略しております。

また、監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士補2名であります。

#### 役員報酬の内容

取締役に支払った報酬	84,614 千円
監査役に支払った報酬	12,570 千円
監査報酬の内容	
監査契約に基づく監査証明に係る報酬	8,900 千円
上記以外の報酬	571 千円

監査報酬以外の報酬は、主に財務調査業務およびその他の調査支援業務に係るものであります。

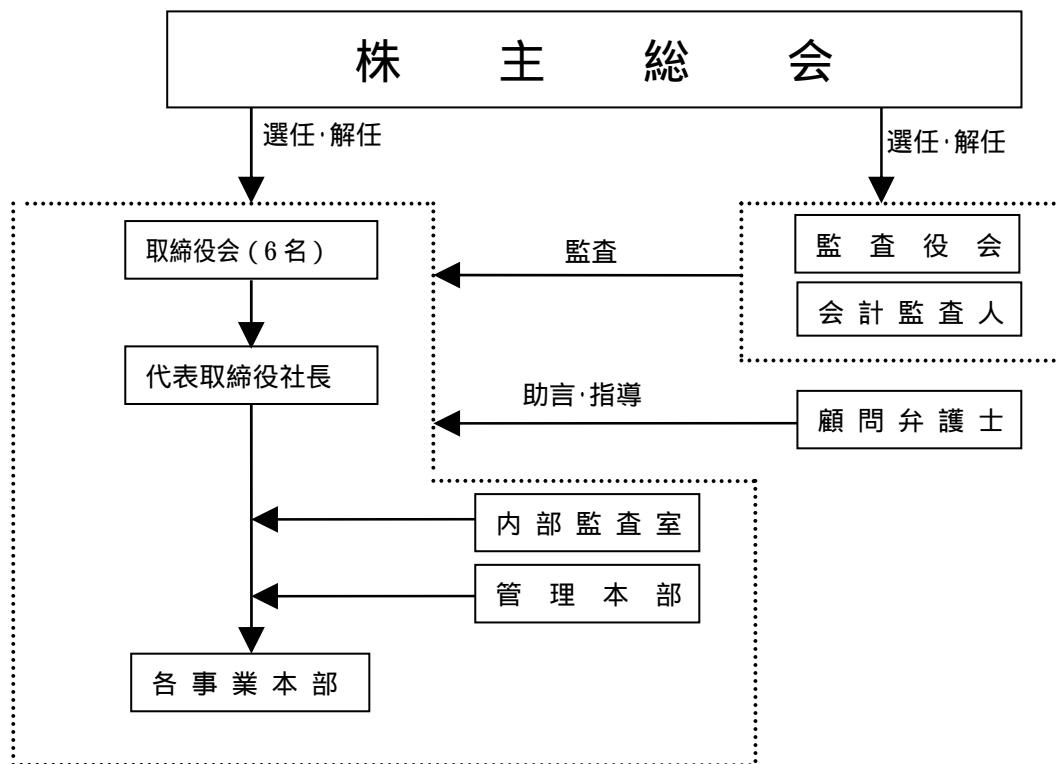
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外監査役のうち中野淑夫氏は、当社の顧問会計士です。木村隆之氏及び藤岡孝雄氏と当社との間に取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社では社外取締役は任命されておりません。

c. 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近 1年間における実施状況

当社では月1回の定例取締役会の開催に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項等について迅速に協議・決議を行っております。業務執行の監視・監督機能をより一層強化するため、昨年10月より監査役を1名増員、監査役は、取締役会およびその他重要な会議に出席し、取締役等からの報告を受けるとともに、定期的な業務監査を実施しております。

#### 業務執行と内部統制図



#### (8) 親会社等に関する事項

当社は親会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

#### (9) 内部管理体制の整備・運用状況

(内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備の状況)

当社の内部管理体制は、社長直轄の内部監査室と管理本部内に経営企画室、経理部、総務部があり、重要な社内情報は必ず管理本部に報告させることにより各業務部門に対する内部牽制が機能するように運営されております。また、社内規定は総務部において、適時整備を実施しております。

(内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況)

平成17年4月1日に「個人情報保護法」が施行されたことに伴い、個人情報保護についての社内体制の構築並びに社員全員に対する教育活動を実施しております。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 当期の概況

当期のわが国経済は、上半期は円高、原油高による景気後退が懸念される中で、企業収益の改善による設備投資動向、雇用情勢や個人消費も力強さを欠きましたが、下半期には企業の設備投資が回復し景気は踊り場から抜け出す状況で推移いたしました。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、昨年夏以降米国向けのデジタル家電の輸出が減少基調となり在庫が積み上がり調整を迫られる状況が続きましたが、その後は在庫調整が進み設備投資も回復過程にあります。海外市場は、北米市場では市場が横ばいであるのに対し、中国・アジア市場はエレクトロニクス機器に対する購買力・生産拠点としての地位が向上し、活況を呈しました。

こうした環境の中、当社の販売の中心分野である各種センサー用途やマイクロマシン用途を中心とする電子部品分野向けの販売が順調に伸びました。アプリケーションの多様化が顕著となり、当社のCVD装置とICPエッティング装置の技術を総合した三次元実装へのニーズも高まりを見せました。LEDに代表されるオプトエレクトロニクス分野では国内で一眼感が見られる一方、中国・アジア市場への広がりを見せました。製品開発では、各種デバイス材料として用途が拡大する化合物半導体分野向けに開発した量産用CVD装置及び微細化・高精度化が進展するマイクロマシン分野や電子部品分野向けに、独口バート・ボッシュ社よりの技術(ボッシュプロセス)導入で開発したシリコンの高速ディープエッティング(深掘)装置の性能向上を図りました。研究開発市場と生産機市場の中間の試作機市場をターゲットとした新製品のCVD装置も市場に投入いたしました。また、当社とキリンビール株式会社で共同開発したペットボトル内壁への炭素薄膜コーティング技術が、ライセンス供与先によって実用化され、装置製造とペットボトル販売の両方で特許権使用料の受取りが始まりました。設立25周年記念事業の一環として薄膜技術セミナーを開催いたしました。ナノテクノロジーでもっとも注目されている分野の一つであるナノフォトニクス技術に焦点を当て、国内外で活躍されている第一線の研究者5名に講演いただきました。

以上のような活動をしてまいりました結果、研究開発用途向けでは前年を上回る売上高1,507,422千円(前期比1.2%増)となりましたが、生産機用途向けでは商談から出荷に至るまでの期間が長く、数件の大型受注案件が来期に持ち越しとなるなど、売上高は1,197,238千円(前期比19.4%減)となりました。また、海外向けでは、前期海外受注に占める割合が5%であった中国が本期は海外受注高トップの37%と大きく躍進しましたが、前期に受注が活発であった台湾が一眼し、米国も大型案件がなかったこと等により海外売上高は549,845千円(前期比4.2%減)となりました。

以上の結果、装置単価は前年比1,687千円増加し21,130千円となったものの、装置の総販売台数が前期の153台から128台へと減少し、売上高は3,090,342千円(前期比8.4%減)、経常利益は263,910千円(前期比35.9%減)となり、当期純利益は166,043千円(前期比33.9%減)となりました。

#### (CVD装置)

当期は装置の大型化が見られ装置単価が46.1%大幅にアップし37,286千円となり“生産機のサムコ”という企業イメージが浸透しつつあることを示しています。一方、前期末まで継続していたデジタルカメラ向けの利益率の良いリピートオーダーは企業の設備投資の手控えから受注再開には至りませんでした。しかし、期中に発表した汎用研究試作用のPD-2203Lは研究開発から生産機への移行段階での試作機市場という新たな需要を創出しました。一方、海外市場におきましては競争が激化したものの、前年並みの売上を確保し、CVD装置の総売上高は857,590千円(前期比5.0%増)となりました。

#### (エッティング装置)

国内市場では電子部品分野で特に自動車や携帯電話に使用されるMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)での需要が拡大しましたが、前期の主力であったオプトエレクトロニクス分野でのLED用途向けに一眼感が見られました。一方、海外では欠陥解析用でのリピートオーダーに加え、LED製造が台湾・中国でも高まったことを受けて、受注を獲得いたしました。この結果売上高は1,476,771千円(前期比14.6%減)となりました。

#### (洗浄装置)

国内ではワイヤーボンディング時の表面処理等で主に生産用のPC-1000が好調でした。一方、海外では、北米市場へ多数の納入実績のある小型装置UV-1が生産用として堅調でしたが、当初期待された中国・アジア市場での生産用途向け販売は価格競争から振るわず、売上高は370,298千円（前期比13.7%減）となりました。

#### (その他装置)

当期の売上高はありません。

#### (その他)

既存装置のメンテナンスや改造及び部品販売が比較的安定的に推移し、売上高は385,681千円（前年比3.5%減）となりました。

#### (品目別売上高)

品目	売上高(千円)	構成比(%)	前期比(%)
CVD装置	857,590	27.7	5.0
エッティング装置	1,476,771	47.8	14.6
洗浄装置	370,298	12.0	13.7
その他装置	-	-	-
その他	385,681	12.5	3.5
合計	3,090,342	100.0	8.4

なお、当社は装置により製造される半導体等電子部品をその用途により、LED・LD関連のオプトエレクトロニクス分野、各種センサー・磁気ヘッド・水晶デバイス・高周波デバイス等の電子部品分野、半導体パッケージ技術や表面洗浄技術等の実装・表面処理分野、有機EL等の表示デバイス分野、その他分野、部品・メンテナンスに分類しており、その売上構成は次のとおりであります。

#### (用途別売上高)

用途	売上高(千円)	構成比(%)	前期比(%)
オプトエレクトロニクス分野	849,805	27.5	23.0
電子部品分野	1,241,493	40.2	12.8
実装・表面処理分野	190,890	6.2	29.7
表示デバイス分野	205,266	6.6	7.3
その他分野	217,204	7.0	21.8
部品・メンテナンス	385,681	12.5	3.5
合計	3,090,342	100.0	8.4

#### (2) 次期の見通し

次期の見通しにつきましては、生産機用途向けで持ち越しとなっていた大型案件がいよいよ業績に寄与してくるのを始めとして、中国・アジア市場での拡販による売上高の急速な拡大を目指します。研究開発用途向け装置は大学・研究機関への着実な販売に加え、共同研究による装置の需要もあり、順調な増加を予想しています。分野別では、オプトエレクトロニクス分野ではLED用途で車載表示機器、交通信号機等アプリケーションの拡大が著しく、これまでの日本メーカーに加えて台湾を始め中国・韓国など新規参入メーカーが増加し海外市場における装置の受注が期待できます。LD用途では販売価格の低下が予想されるものの、DVD(Digital Video Disk)、光ファイバーなど応用製品の市場の拡大も予想され、生産用のCVD装置、エッティング装置の受注が期待されます。また、電子部品分野では携帯電話、デジタルカメラなどの小型、高機能化によって三次元実装による高密度化が推進され、CVD装置とエッティング装置のセット販売も期待できます。更に引き続きボッシュプロセスを搭載したシリコンの深掘りエッティング装置RIE-200iPBや、欠陥解析用途でのエッティング装置の拡販にも注力いたします。洗浄装置につきましては、北米・東南アジアを中心に販売を強化いたします。売上総利益率

は海外市場における競争激化が予想されるものの、研究開発用装置と比較し利益率のよい生産機の売上比率が増すこと、部品仕入れから一貫した原価低減と装置・部品の標準化の推進等から 50%を目指とします。販売費及び一般管理費は研究開発および中途採用人材に関する人件費の増加は見込まれますが、コスト削減活動の一層の強化により固定費の増加要因は限定的と見られ、対売上高比率は低下できるものと予想されます。

以上の見通しにより、売上高は 4,100 百万円（当期比 32.7% 増） 経常利益は 740 百万円（当期比 180.4% 増） 当期純利益は 444 百万円（当期比 167.4% 増）となる見込みであります。

### (3) 財政状態

#### (流動資産)

当期末における流動資産は、3,582 百万円で前期末に比べ 92 百万円減少いたしました。売掛債権は受取手形が 141 百万円減少しましたが、売掛金が 150 百万円増加し大きな増減とはなりませんでしたが、たな卸資産が 75 百万円減少し、借入金の返済等により現金及び預金が 26 百万円減少いたしました。

#### (固定資産)

当期末における固定資産の残高は、3,247 百万円で前期末に比べ 74 百万円減少しました。主な減少要因は、投資有価証券で 44 百万円、建物の減価償却で 38 百万円であります。

#### (流動負債)

当期末における流動負債の残高は、1,351 百万円で前期末に比べ 119 百万円減少しました。買掛金が 81 百万円、一年以内返済予定長期借入金が 33 百万円減少する一方、短期借入金の純増加額 50 百万円となりました。

#### (固定負債)

当期末における固定負債の残高は、432 百万円で前期末に比べ 111 百万円減少しました。長期借入金の純減少額 112 百万円が主な要因であります。

#### (資本)

当期末における資本の残高は、5,046 百万円で前期末に比べ 63 百万円増加しました。これは、利益剰余金が 89 百万円増加したことなどによります。自己資本比率は前期比 2.7 ポイント上昇し、73.9%となりました。

### (4) キャッシュ・フローの状況

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は税引前当期純利益が 263,910 千円（前期比 36.1% 減）となり、たな卸資産の減少額 64,193 千円がプラスに寄与したものの、借入金の返済 95,334 千円（うち短期借入金純増加額 50,666 千円、長期借入金純減少額 146,000 千円）などにより、資金残高は前期末に比べ 48,034 千円減少し、当期末には 1,122,298 千円（前期比 4.1% 減）となりました。

また、当期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は 168,039 千円（前期比 58.6% 減）となりました。これは主にたな卸資産の減少額 64,193 千円がプラスに寄与したものの、税引前当期純利益が 263,910 千円（前期比 36.1% 減）となり、仕入債務の減少額 81,818 千円、役員退職慰労引当金の減少額 14,138 千円、売上債権の増加額 9,919 千円であったことによるものです。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は 47,568 千円（前期比 31.5% 減）となりました。その主な内容は定期預金の払出による収入 1,716,534 千円に対して、定期預金の預入による支出が 1,738,112 千円であったこと、有形固定資産の取得による支出が 25,639 千円であったことによるものです。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は 168,670 千円（前期比 58.6% 減）となりました。これは、短期借入金の純増加額が 50,666 千円であった一方、長期借入金の返済による支出が 146,000 千円であったことによるものです。

なお、直近 5 事業年度におけるキャッシュ・フロー指標の推移は次のとおりであります。

	平成 13 年 7月	平成 14 年 7月	平成 15 年 7月	平成 16 年 7月	平成 17 年 7月
自己資本比率 (%)	58.3	65.1	66.1	71.2	73.9
時価ベースの自己資本比率 (%)	137.5	142.1	130.0	167.7	134.9
債務償還年数 (年)	4.5	4.1	15.2	2.5	5.4
インタレスト・カバレッジ・レシオ	13.8	14.0	3.8	21.7	11.7

(注) ·自己資本比率： 自己資本 / 総資産

·時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額 / 総資産

·債務償還年数： 有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

·インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー / 支払利息